

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成29年2月16日 (2017.2.16)

【公表番号】特表2016-506620(P2016-506620A)

【公表日】平成28年3月3日 (2016.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2016-013

【出願番号】特願2015-547452(P2015-547452)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 31/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/14 C

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 29/78 6 1 8 Z

H 0 1 L 29/78 6 2 6 C

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 31/10 A

【手続補正書】

【提出日】平成28年12月27日 (2016.12.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 1】

ここで、金属酸化物層 4 0 が T F T 4 2 と P I N ダイオード 2 0 の間の透明なコンタクト層として役立つ点に留意する必要がある。透明な接点 (T F T 4 2 とフォトダイオード 2 0 間の金属酸化物層 4 0) は、金属酸化物エッチマスク (4 回目のマスク工程)、エッチストップマスク (5 回目のマスク工程) および S / D 電極エッチマスク (6 回目のマスク工程) を通して作製される。このように、フォトダイオード 2 0 の透明なトップ電極を形成するにあたって更なる堆積またはマスクング工程を必要としない。